

# 第187回講演会

【開催：平成26年10月24日（金）】

主催 中国地区化学工学懇話会,  
CREST「多様な水源に対応できるロバストRO/NF膜の開発」

下記の要領で講演会を開催します。多数の方のご参加を頂きますようお願い致します。

## 記

日 時：平成26年10月24日（金）15：00～17：00

場 所：広島大学 工学部108講義室

交 通：山陽本線西条駅下車、バス15分、大学会館前下車  
山陽新幹線東広島駅下車、タクシー10分  
広島バスセンターから直行バス約1時間、大学会館前下車

講 演：「化学蒸着によるシリカ膜の最先端」

講 師：野村 幹弘 氏

芝浦工業大学 工学部 応用化学科 教授

講演内容：近年、シリカ膜作製時に有機物を導入することで、細孔径制御を含め、様々な機能を付与する研究が進んでいる。当研究グループでは、化学蒸着（CVD）法の一つである、対向拡散CVD法をベースとして、ガス分離（二酸化炭素系、メタン系 etc）、有機物分離（ベンゼン系、テトラリン系 etc）、逆浸透分離（塩化ナトリウム系、硫酸系）といった様々な分離系に適した膜を開発してきた。本講演は、上記の各種分離実験結果をベースとし、蒸着メカニズムや将来の応用分野など、シリカ膜の最先端について幅広く議論できる内容とする予定である。

参加費：無料

申込先：FAX または電子メールでお申し込み下さい。

中国地区化学工学懇話会

TEL 082-424-7718 FAX 082-424-5494 E-mail(ysasa@hiroshima-u.ac.jp)